基于 Zemax 软件的准分子激光模拟

靳羽华 赵 艳 蒋毅坚

(北京工业大学激光工程研究院,北京 100124)

摘要 提出了一种模拟准分子激光光能量分布的方法。通过使用 Matlab 软件分析实际拍摄到的准分子激光光能量分布彩色图像并提取相关信息进行计算,使用光学软件 Zemax 模拟出实际的准分子激光的光能量分布。实际准分子光源光斑的尺寸约为16.5 mm×35.4 mm,光束在 x 方向的发散角度约为3.3 mrad,在 y 方向的发散角度约为11.5 mrad。使用该方法所模拟的光源的光斑尺寸约为16.7 mm×35.3 mm,光束在 x 方向的发散角度约为3.41 mrad,在 y 方向的发散角度约为11.53 mrad,光能量分布在细节上与实际光源保持一致。该方法解决了准分子激光光能量空间分布较为复杂难以进行光学模拟的问题,同时也为准分子激光的光学特性研究以及应用于准分子激光光学元件的研发提供了技术基础。

关键词 激光光学;准分子激光;能量分布建模;Zemax软件
 中图分类号 TN247 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201340.0902010

Simulation of Excimer Laser Based on Zemax Software

Jin Yuhua Zhao Yan Jiang Yijian

(Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract A method to simulate the energy distribution of excimer laser is provided. The color image of an actual excimer laser energy distribution is captured, and the image and extract relevant information are analyzed using Matlab software. Meanwhile the actual excimer laser light source is simulated by the optical software Zemax. The beam dimension of the actual excimer laser light source is about 16.5 mm \times 35.4 mm. The beam divergence is about 3.3 mrad in the x direction, and 11.5 mrad in the y direction. The beam dimension of the light source simulated by this method is about 16.7 mm \times 35.3 mm, and the beam divergence is about 3.41 mrad in the x direction, and 11.53 mrad in the y direction. The energy distribution of the simulated light is consistent with that of the actual excimer laser light in details. This method provides a perfect solution to the optical simulation difficulty of the complex spatial energy distribution of the excimer laser. It also provides a technical foundation for the investigation on the optical property of excimer laser and development of its optical components.

Key words laser optics; excimer laser; energy distribution simulation; Zemax software

OCIS codes 200.4560; 100.2960; 140.3300; 140.7240

1 引

准分子激光器是在激光辐射源中运用日益广泛 的紫外波段激光器。由于稀有气体卤化物的准分子 激光具有脉冲能量大、峰值功率高且波长在紫外区 域的优点,很快就引起了研究人员对高功率、高能 量、高平均功率、高重复频率激光器的兴趣^[1],使得 准分子激光广泛地应用于科研、医疗和工业等诸多 领域。在科研方面,准分子激光用于激光诱导荧光 检测多环芳烃类物质和脉冲激光沉积;医疗方面,准 分子激光可用于眼科疾病和皮肤病治疗等;工业领 域,可利用准分子激光进行低温硅退火、高密度电路 板制作和布拉格光栅制作等^[2]。早在 1960 年, Houtermans^[3]就提出了准分子束缚-自由电子跃迁 产生增益的思想,即以准分子为激活介质来实现激

E-mail: yuyuyusuke@126.com

言

导师简介:蒋毅坚(1962—),男,教授,主要从事激光先进制造技术方面的研究。E-mail: yjjang@bjut.edu.cn

收稿日期: 2013-03-29; 收到修改稿日期: 2013-04-29

基金项目: 国家自然科学基金(10974009)、北京市自然科学基金 B类重点项目(JC101311201201)

作者简介: 靳羽华(1988—), 男, 硕士研究生, 主要从事激光先进制造外光路系统方面的研究。

光振荡。1970年,Bosov等^[4]采用强流电子束激发 液态 氙得到 Xe₂ 准分子激光,输出激光波长为 172 nm,这是首次用准分子跃迁得到激光振荡。此 后研究人员先后实现了 XeF、KrF、ArF、XeCl、 KrCl、ArCl等准分子激光^[5-7],激励方式也由纯电 子束扩展到自持放电、预电离放电等多种形式^[8],其 波段主要是 193 nm (ArF)、248 nm (KrF)、308 nm (XeCl)以及 351 nm(XeF)^[9]。

准分子激光离不开惰性气体和卤素气体,这也 决定了准分子激光器的工作方式[10]。准分子激光 器的混合气体在受到能量的激发后,在一系列物理 及化学反应中形成的分子并不稳定,其寿命仅为几 十毫微秒[11]。这就需要高气压和高电压来不断维 持激光的输出,而气压和电压本身的不稳定极易导 致增益本身的不均匀和输出窗的热扩散不稳定,从 而使得输出光束的横截面能量分布不均匀。通常情 况下输出的激光为高阶多模式光束,光束的横截面 能量分布较为复杂,光能量在X方向为高斯分布,Y方向为近平顶分布,目光能量的分布会随准分子激 光器的使用条件而发生变化[12]。对于激光加工或 者科研应用,要求光源具有很好的光束均匀性,为此 国内外研究人员对准分子激光能量均匀化做了大量 的分析和研究[13-16]。对于空间分布较复杂的激光 光束,目前只有通过简单的光学计算模拟或者用单 一的光学光源来进行替代模拟的报道。

本文提供了一种方法,通过实际拍摄到的准分 子激光光能量分布图像,计算并分析其光能量的分 布规律,使用光学软件 Zemax 模拟出实际测试到的 准分子激光光能量分布,为准分子激光的光学特性 研究以及应用于准分子激光光学元件的研发提供了 技术基础。

2 准分子激光光能量分布

为了得到准分子激光的能量分布特征,对德国 Lambda Physik 公司生产的 LPXpro 305iF 型 KrF 准分子激光器进行了研究,该激光器输出激光的波 长为248 nm,最高单脉冲能量为1200 mJ,最高重复 频率为50 Hz,平均功率为60 W。

实验中将准分子激光器的脉冲能量调整至 500 mJ,脉冲频率设置为2 Hz。在距离出光口 50 cm处放置投射屏幕,调整光路使激光光斑可以 完整投射到屏幕中心。使用美国 SPIRICON 公司 的 LBA-usb-L230 型激光光束分析仪对靶面的激光 光斑能量分布进行实时跟踪捕捉。将图像捕获模式 调整为视频触发模式,当激光脉冲被检测到时,抓获 该帧,如此便可得到准分子激光光斑能量分布的彩 色图像,如图1所示。



图 1 激光光束分析仪得到的准分子 激光能量分布彩色图像 Fig. 1 Color image of energy distribution shoted by laser beam analyzer

由光斑能量分布图可以直观得到准分子激光能量分布的特性:光斑在 X 方向近似为高斯能量分布,在 Y 方向则为一个不规则的能量分布:总的来说,整个光斑呈现出中心光强度大,周边光强度逐渐减弱的一个能量分布状态。从空间光学的角度来分析,该激光光束实际上是一个空间能量分布较复杂的激光光束^[17]。

3 数学模型的建立及模拟方案

首先从光学和数学的角度去分析激光的叠加。 在波动光学中,激光的光场可用定态标量波来描述。 对于超高斯光束在自由空间的传输,柯林斯公式给 出详细的解释^[18],传输 *z* 距离后光场强度为

 $E(r,z) = U(r,z) \exp\{i[kz + \varphi(r,z)]\}, \quad (1)$ U(r,z) =

$$2\pi F \int_{0}^{+\infty} \exp(-v^{n}) J_{0}\left(2\pi F v \frac{r}{w_{0}}\right) \exp(i\pi F v^{2}) v dv, \quad (2)$$

$$\varphi(r,z) = \frac{kr^{2}}{2z} +$$

$$\arg \left[\int_{0}^{+\infty} \exp(-v^{r}) \mathbf{J}_{0} (2\pi F v \frac{r}{w_{0}}) \exp(i\pi F v^{2}) v \mathrm{d}v \right], (3)$$

式中 J₀ 为零阶贝塞尔函数; F 为与光束相关的菲涅 耳数, $F = w_0^2/\lambda_z$,其中 w_0 为光束束宽, λ 为激光波 长;k 为波数;v 为积分中间变量;n 为幂级数。光强 为复振幅的模方,即

$$I_{2}(r,z) = E(r,z)E^{*}(r,z).$$
(4)

根据波的叠加原理,多列波同时存在时,交叠区

域内每点的振动是各列波单独在该点产生的振动的 合成,其数学表达式为

$$E(r,z) = \sum_{i=1}^{\infty} E_i(r,z), \qquad (5)$$

而总光强应为

$$I = |E(r,z)|^{2} = \Big| \sum_{i=1}^{\infty} E_{i}(r,z) \Big|^{2}.$$
(6)

将(5)式代入(6)式就可以得到相干叠加后的光强。 而对于非相干叠加情况下的光强,则为各光束光强 的简单相加。

通过分析超高斯光能量叠加的数学模型,制定 出模拟实际准分子激光光源的方案:首先要使用数 学软件 Matlab 对光强度能量分布图像进行分析,并 且提取出相关的数据生成光强度分布图;再用得到 的光强分布图像进行数据拟合分析,得到光能量分 布的规律并且生成各子光源的模型参数;最后在 Zemax 软件非序列模式下,用计算所得到的参数建 模,测试光能量叠加后的结果。

4 基于 Matlab 软件的图像信息提取

对于该彩色图像,想要挖掘其中的数据信息,就 需要使用 Matlab 软件强大的图像处理功能来分析 图像本身的色彩值来实现。使用程序在 Matlab 软 件中导入图像,应用程序会对所有的像素进行分析。 每个像素会被图像识别成为一个独立的点{*x*,*y*}, 每个点会包含独立的信息^[19],对于真彩色的图像, 每个像素的色彩都是用 RGB 三种颜色的灰度组合 来 实现,根据 RGB 三种颜色的灰度值,总共有 256×256×256=16777216种颜色^[20]。

由于该图像色彩的编辑函数和色彩的合成函数 均为未知函数,因此从数学的角度去计算是较为困 难的。如果根据各像素所携带的色彩信息直接来计 算各点的光强度,则必须明确知道图像中光强度变 化和色彩变化之间的对应关系,这种对照关系称为 colormap 软件。使用 LBA-sub-L230 客户端软件分 析出图像的 colormap,如图 2 所示,可得到对应此 colormap 的 RGB 数值。



图 2 LBA-usb-L230 客户端软件处理图像的 colormap Fig. 2 Colormap of the processed images by LBA-usb-L230 client software

将 colormap 编辑成一个数值矩阵,并且对应其 色彩建立一个强度值的映射。使用 Matlab 软件编辑 程序依次扫描图像中所有像素的 RGB 值,建立循环 语句和 colormap 矩阵进行对照,若符合相应的 color 则将强度值赋予该点。由此得到了图像中各像素所 代表的光强度,进一步利用坐标变换等手段得到光斑 在 x,y 方向上的光强度分布数据,如图 3 所示。



图 3 光能量密度分布数据。(a) x 方向;(b) y 方向 Fig. 3 Energy intensity distribution data. (a) x direction; (b) y direction

5 数据拟合分析

为了更好地模拟该准分子激光光源,选用高阶 高斯光源为子光源模型。在 Zemax 软件中代表高 阶高斯光源光强度分布的多项式为

$$I(\theta_x, \theta_y) = I_0 \exp\left\{-2\left[\left(\frac{\theta_x}{\alpha_x}\right)^{2G_x} + \left(\frac{\theta_y}{a_y}\right)^{2G_y}\right]\right\},$$

(7)式为高阶高斯光源的远场光强度分布公式,式中 若光场沿 X 方向入射,则 α_x 为 x_z 方向的衍射角, G_x 为x方向的超级高斯因数,若 $G_x = 1.0$,那么该光源 能量分布曲线为标准的高斯曲线,若 $G_x > 1.0$,曲线 会趋近于方形;若光场沿y方向入射 α_y 为yz方向的 衍射角, G_y 为y方向的超级高斯因数,且 G_x 和 G_y 都 必须大于等于 0.01。

若同时考虑 x 方向和 y 方向,则要进行数据的 二维拟合,过程较复杂。因此试着由一个方向分析 入手,若两个光源叠加,则建立基本模型。假设两个 高阶高斯光叠加,建立如下公式

$$I(x) = I_1 \exp\left[-2\left(\frac{x-a_1}{b_1}\right)^{2G_1}\right] + I_2 \exp\left[-2\left(\frac{x-a_2}{b_2}\right)^{2G_2}\right],$$
 (8)

$$I(y) = I_1 \exp\left[-2\left(\frac{y-c_1}{d_1}\right)^{2G_3}\right] + I_2 \exp\left[-2\left(\frac{y-c_2}{d_2}\right)^{2G_4}\right], \quad (9)$$

(8)式为 x 方向的光强度叠加, a_1 、 a_2 为两个高阶高 斯光源在 x 方向距离坐标原点的倾斜量。 b_1 、 b_2 为两 个光源的发散角度。(9) 式为 y 方向的光强度叠加, c_1 、 c_2 为两个高阶高斯光源在 x 方向距离坐标原点 的倾斜量, d_1 、 d_2 为两个光源的发散角度。

基于非线性最小二乘法,加入二次平方的暴力 趋近条件,限制拟合的边界条件后利用 Matlab 软件 得到了一个较为理想的拟合结果,并计算出了公式 中的未知参数,如图 4 所示。



图 4 利用 Matlab 软件对光源能量分布数据拟合 Fig. 4 Light source energy intensity distribution data fitted by Matlab soft ware

6 基于 Zemax 光学软件的光源建模

使用 Zemax 光学设计软件在非序列模式下建立 两个高阶高斯光源,并设置参数使两个高斯光源叠加 进行追迹,在距离光源一定的距离上设置虚拟的光探 测器以检测光能量分布的状态,将上面通过 Matlab 软件计算得到的参数输入 Zemax 软件生成模型。在 虚拟光探测器上得到了所模拟的光斑,模拟得到的光 能量密度分布和实际拍摄的准分子激光光斑得到的 光能量密度分布在细节上保持一致,如图 5 所示。

图 5(a),(b)分别为虚拟光探测器所得到的模 拟光斑在 x 方向和 y 方向上的光能量分布。两者 叠加后最终得到一个理想的模拟结果,模拟光能量 分布与原始拍摄得到的光能量密度分布对比图如 图 6所示。



图 5 Zemax 软件中模拟光源在光探测器上得到的光能量密度分布。(a) *x* 方向; (b) *y* 方向 Fig. 5 Energy intensity distribution of virtual light source in Zemax software. (a) *x* direction; (b) *y* direction

实际光源光斑的尺寸约为 16.5 mm × 35.4 mm,光束在 x 方向的发散角度约为3.3 mrad, 在 y 方向的发散角度约为 11.5 mrad。基于 Zemax 软件所模拟光源与实际光源相符,由探测器平面坐 标易知其光斑尺寸约为 16.7 mm×35.3 mm,其光 束在 x 方向的发散角度约为3.41 mrad,在 y 方向的发散角度约为11.53 mrad。由 LBA-usb-L230 激光光束分析仪拍摄得到的实际激光光斑的能量分布曲线与使用 Zemax 软件模拟光源得到的光斑能量分布曲线的对比如图 7、8 所示。







图 7 *x* 方向光能量曲线对比





图 8 y方向光能量曲线对比 Fig. 8 Comparison of light energy curves along the y direction

7 结 论

提供了一种方法来模拟准分子激光的光源。通 过使用 Matlab 软件分析实际拍摄到的准分子激光 光能量分布彩色图像,并利用相关信息计算出光强 度分布的规律,使用光学软件 Zemax 模拟出实际的 准分子激光光源。解决了由于准分子激光光能量空 间分布较为复杂难以进行光学模拟的问题。该方法 的实现为准分子激光的光学特性研究扩展了新的思 路;同时对应用于准分子激光光学的光学系统,如激 光微加工系统、激光整形均束系统、激光扩束系统、 激光聚焦系统等系统的设计和研发提供了技术 基础。

参考文献

- Lou Qihong. Progress of excimer lasers and its applications[J]. Chinese J Lasers, 1994, 21(5): 361-364. 楼祺洪. 准分子激光器的发展和应用[J]. 中国激光, 1994, 21 (5): 361-364.
- 2 Yu Yinshan, You Libing, Liang Xu, *et al.*. Progress of excimer lasers technology [J]. Chinese J Lasers, 2010, 37 (9): 2264-2266.

余吟山,游利兵,梁 勖,等. 准分子激光技术发展[J]. 中国激 光,2010,37(9):2264-2266.

- Lou Qihong, Xu Jie, Fu Shufen, et al.. Pulsed Gas Discharge Lasers[M]. Beijing: Science Press, 1993, 243.
 楼祺洪,徐 捷,傅淑芬,等.脉冲放电气体激光器[M].北京: 科学出版社, 1993, 243.
- 4 N G Basov, V A Danilychev, Y M Popov, *et al.*. Laser operating in vacuum region of spectrum by excitation of liquid xenon with an electron beam[J]. JETP Letters, 1970, 12(10); 329-331.
- 5 H A Koehler, L J Ferderber, D L Redhead, et al.. Stimulated VUV emission in high pressure xenon excited by high current relativistic electron beams[J]. Applied Physics Letters, 1972, 21 (5): 198-200.
- 6 J E Velazco, D W Setser. Bound free emission spectra of diatomic xenon halides [J]. J Chemical Physics, 1975, 62 (5): 1990-1991.
- 7 S K Searles, G A Hart. Stimulated emission at 281.8 nm from XeBr[J]. Applied Physics Letters, 1975, 27(4): 243-245.
- 8 M K Makarov. Once upon a time: a hearty glance over the 30 year history of excimer lasers[C]. SPIE, 2005, 5777; 542-547.
- 9 D Lo. The role of halogen donors in discharge instability of raregas halide excimer lasers[J]. Applied Physics B, 1989, 49(6): 535-540.
- 10 A Vill. Principles and technology of excimer lasers[J]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fuusika Instituudi Uurimused, 1984, 56: 18-37.
- 11 M Maeda. Principles of excimer light sources [J]. Review of Laser Engineering, 1995, 23(12): 1027-1037.
- 12 Ye Zhenhuan, Li Hongxia, Lou Qihong, et al.. Beam profile diagnosis technology for excimer laser[J]. High Power Laser & Particle Beams, 2004, 16(5): 619-622.

叶震寰,李红霞,楼祺洪,等.准分子激光的光束波面测量技术

[J]. 强激光与粒子束, 2004, 16(5): 619-622.

- 13 Li Chengde, Chen Tao, Zuo Tiechuan. Design of fly's eye homogenizer for excimer laser micromachining [J]. Chinese J Lasers, 1999, 26(6): 560-564.
 李呈德,陈 涛, 左铁钏. 两级复眼式准分子激光微加工均匀器的设计[J]. 中国激光, 1999, 26(6): 560-564.
- 14 Ye Zhenhuan, Lou Qihong, Li Hongxia, et al.. Beam homogenizing technology for UV excimer laser [J]. Laser Technology, 2005, 29(2): 207-212. 叶震寰,楼祺洪,李红霞,等.准分子激光光束均匀技术[J].激 光技术, 2005, 29(2): 207-212.
- 15 M Zimmermann, N Lindlein, R Voeikel, *et al.*. Microlens laser beam homogenizer: from theory to application[C]. SPIE, 2007, 6663(1): 1-13.
- 16 T Kajava, A Hakola, H Elfstrom, et al.. Flat-top profile of an excimer laser beam generated using beam-splitter gratings [J]. Opt Commun, 2006, 268(2): 289-291.
- 17 A Masters, T Geuking. Beam-shaping optics expand excimer laser applications [J]. Laser Focus World, 2005, 41 (66): 99-103.
- 18 Lü Baida. Laser Optics [M]. Beijing: Higher Education Press, 2003: 223-249.

吕百达. 激光光学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 223-249.

19 Tang Jiyu, Sang Ziqin. Computation for color image rendering on visible spectra [J]. J Optoelectronics • Laser, 2001, 12(6): 631-634.

唐吉玉, 桑梓勤. 可见光谱的彩色图像着色计算[J]. 光电子・激光, 2001, 12(6): 631-634.

20 P Rattanasakornchai, Y Hoshino, T Shimizu. Extraction of the characteristic points for motion detection by using color information[C]. SPIE, 2002, 4666: 141-148.

栏目编辑:张 腾